

Product Information Sheet

AWC® UF-434

Limpiador de bajo pH para Membranas UF/MF

VENTAJAS

- Compuesto limpiador en polvo de bajo pH diseñado para remover incrustaciones de carbonato y fosfato de la superficie y poros de membranas MF/UF
- Disuelve y remueve efectivamente hierro, aluminio y otros óxidos metálicos.
- Bufferado para mantener un rango de pH estable incluso cuando ocurre una sobredosis accidental
- Compatible con la mayoría de módulos MF/UF
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Líquido amarillo claro a amber
Olor	Olor Característico
Solubilidad en Agua	Completa
pH @ 25°C	< 2
Gravedad Específica	1.35 ± 0.05

EMPAQUE

Contenedores plásticos de 5 galones, tambores de 55 galones, y contenedores de 275 galones

SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco, seco, y bien ventilado. Mantenga los contenedores cerrados. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

La solución limpiadora debe ser preparada usando agua potable libre de cloro residual u otros agentes oxidantes (permeado de OI o agua DI es preferido). Prepare la solución de limpieza adicionando 17 lbs de AWC UF-434 por cada 100 galones de agua (solución al ~2% en peso), dependiendo de la severidad del ensuciamiento. Calentar el agua a la máxima temperatura permitida por el fabricante del módulo. Hacer circular la solución limpiadora a través de los módulos con la válvula de filtrado cerrada en la dirección de la alimentación por 30 minutos (para diseños tubulares), manteniendo el pH entre 2 - 3. La dirección del flujo puede ser reversada y circulada por 30 minutos más. Mida el pH cada 15 minutos. Si el pH disminuye por debajo del rango objetivo, adicione más AWC UF-434 para mantener un rango de pH entre 2-3 durante todo el proceso de limpieza. Repita como sea necesario hasta que el pH de la solución se mantenga estable por 2 lecturas consecutivas. Para los sistemas que permiten retro-lavados se puede hacer con la solución de limpieza desde el lado de filtrado a lado de alimentación por 15 minutos. Después de terminar la limpieza, los módulos deben ser enjuagados con filtrado MF/UF.

